

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 6 部門第 2 区分

【発行日】平成 25 年 6 月 6 日 (2013.6.6)

【公表番号】特表 2009-518674 (P2009-518674A)

【公表日】平成 21 年 5 月 7 日 (2009.5.7)

【年通号数】公開・登録公報 2009-018

【出願番号】特願 2008-543866 (P2008-543866)

【国際特許分類】

G 0 2 B 5/18 (2006.01)

G 0 3 H 1/20 (2006.01)

G 0 2 C 7/00 (2006.01)

G 0 2 B 5/30 (2006.01)

G 0 2 B 3/00 (2006.01)

【 F I 】

G 0 2 B 5/18

G 0 3 H 1/20

G 0 2 C 7/00

G 0 2 B 5/30

G 0 2 B 3/00 Z

【誤訳訂正書】

【提出日】平成 25 年 4 月 18 日 (2013.4.18)

【誤訳訂正 1】

【訂正対象書類名】特許請求の範囲

【訂正対象項目名】全文

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

ミクロン スケールのパターン ( P ) を光学製品 ( 1 ) の表面上に転写する方法であって、

a ) 転写されるパターンに対応したミクロン スケールまたはサブミクロン スケールに画定されたマイクロ レリーフを構成する凹部 ( 1 2 ) 及び突起部 ( 1 3 ) を持つスタンプの表面上に、少なくとも 1 つの転写可能な材料の層を堆積する段階と；

b ) 光学製品の基板表面上に液状のラテックス層を堆積する段階と；

c ) 前記ラテックス層が乾燥する前に、転写可能な材料の層を含む前記スタンプの表面をラテックス層に接触させる段階と；

d ) 前記スタンプに圧力を加える段階と；及び、

e ) 前記ラテックス層を備える前記光学製品の表面から前記スタンプを取り除く段階と；

を備え、

前記転写されたパターン ( P ) はホログラフィックパターンであり、  
前記パターンの部位において、光線 ( 1 0 1 ) が前記レンズ ( 1 ) を通り抜けるまたは前記レンズ上で反射される時、ホログラフィックパターン ( P ) は、読取画像を形成するように構成される、方法。

【請求項 2】

ミクロン スケールのパターンは 1 つまたはそれ以上の個々のパターンを備え、それぞれのパターンは 1 0  $\mu$  m から 5 0 n m の範囲の寸法を持つ、請求項 1 に記載の方法。

【請求項 3】

前記凹部（１２）及び前記突起部（１３）の寸法は、前記スタンプの表面に平行に測定し、１０マイクロメートルから５０ナノメートルの範囲である、請求項１または請求項２に記載の方法。

【請求項４】

前記凹部１２の深さは０．１μｍから３０μｍの範囲である、請求項１から請求項３のいずれか１項に記載の方法。

【請求項５】

前記転写されたパターン（Ｐ）は振幅ホログラム型のホログラフィックパターンである、請求項１に記載の方法。

【請求項６】

前記転写されたパターン（Ｐ）は位相ホログラム型のホログラフィックパターンである、請求項１に記載の方法。

【請求項７】

前記転写されたパターンは、一式の隣接するピクセルによって構成されるデジタルホログラム型のホログラフィックパターンであり、それぞれのピクセルは０．２μｍ<sup>２</sup>から２５μｍ<sup>２</sup>の範囲の表面積を持つ、請求項１に記載の方法。

【請求項８】

前記転写されたパターン（Ｐ）は、前記光学製品（１）の表面のごく一部を占める、請求項１から請求項７のいずれか１項に記載の方法。

【請求項９】

前記転写されたパターン（Ｐ）は、前記製品（１）の表面の２５ｍｍ<sup>２</sup>未満の部分占める、請求項８に記載の方法。

【請求項１０】

前記ラテックス層（２）は、回転塗布法を利用し前記光学製品（１）の表面上に堆積される、請求項１に記載の方法。

【請求項１１】

前記ラテックス層の厚さは、０．２μｍから５０μｍの範囲である、請求項１０に記載の方法。

【請求項１２】

前記スタンプの表面の突起部（１３）上に配置された転写可能な材料の層（１４）が前記製品の表面上に選択的に転写される条件下にて、段階ｃ）において、前記スタンプの表面（Ｓ）を、前記ラテックス層（２）を保持する前記光学製品（１）の表面に接触させる、請求項５に記載の方法。

【請求項１３】

段階ｃ）において、前記パターンＰの突起部の表面にて０．１ｇ／ｍｍ<sup>２</sup>から６０ｇ／ｍｍ<sup>２</sup>の範囲の圧力とした状態で、前記スタンプの表面（Ｓ）を、前記ラテックス層（２）を保持する前記光学製品（１）の表面に接触させる、請求項１２に記載の方法。

【請求項１４】

前記スタンプの表面上の突起部（１３）は前記ラテックス層に完全に浸入し、及び前記スタンプの表面上の突起部（１３）上に配置される前記転写可能な材料の層の部分及び前記スタンプの凹部（１２ｂ）内に配置される前記転写可能な材料の層の部分が前記光学製品の表面上と一緒に転写される条件下にて、段階ｃ）において、前記スタンプの表面（Ｓ）を、前記ラテックス層（２）を保持する前記光学製品（１）の表面に接触させる、請求項６に記載の方法。

【請求項１５】

段階ｃ）において、前記パターンＰの突起部の表面にて６０ｇ／ｍｍ<sup>２</sup>よりも大きな圧力で、前記スタンプの表面（Ｓ）を、前記ラテックス層（２）を保持する前記光学製品（１）の表面に接触させる、請求項１４に記載の方法。

【請求項１６】

段階ａ）及び／又は段階ｅ）の後に実行される、

f) 1つまたはそれ以上の機能付与されたコーティングによって前記光学製品の表面を覆う段階；

をさらに備える、請求項 1 に記載の方法。

【請求項 17】

前記機能付与されたコーティングは、耐衝撃、耐磨耗、反射防止、汚染防止、曇り防止、帯電防止、偏光、着色、又は光発色性の機能を持つ、請求項 16 に記載の方法。

【請求項 18】

段階 e) の後に、付加的な段階 f) が実行される、請求項 16 または請求項 17 に記載の方法。

【請求項 19】

前記転写可能な材料は金属材料である、請求項 1 に記載の方法。

【請求項 20】

前記転写可能な材料は、金、アルミニウム、クロム、銀、銅、ニッケル、白金、パラジウム、及び前記金属の少なくとも 1 つを含む合金から選択される、請求項 19 に記載の方法。

【請求項 21】

前記転写可能な材料の層は、段階 a) において、真空蒸発または真空陰極スパッタリングによって前記スタンプの表面 (S) 上に堆積される、請求項 19 または請求項 20 に記載の方法。

【請求項 22】

前記転写可能な材料の層 (14) は、それぞれの材料の層の複数を含むスタックを備える、請求項 19 から請求項 21 のいずれか 1 項に記載の方法。

【請求項 23】

前記スタックの少なくとも 1 つの層の材料は屈折性である、請求項 22 に記載の方法。

【請求項 24】

前記スタンプの表面 (S) の少なくとも突起部 (13) の部位において、前記スタンプはポリジメチルシロキサンを基礎としている、請求項 1 に記載の方法。

【請求項 25】

前記スタンプは、前記光学製品の基板上の接触する地点の法線と平行に近づけられる、請求項 1 に記載の方法。

【請求項 26】

段階 c) において、生成品表面の曲率に応じ、前記生成品 (1) の表面に前記スタンプが接触されている間、前記スタンプの表面 (S) は、変形するように構成される、請求項 1 から請求項 25 のいずれか 1 項に記載の方法。

【請求項 27】

段階 b) の前に実行される、前記光学製品 (1) の表面を処理する段階をさらに備える、請求項 1 から請求項 26 のいずれか 1 項に記載の方法。

【請求項 28】

前記光学製品 (1) は、光学機器レンズ、観察レンズ、バイザー、及び眼科用レンズから選択される、請求項 1 に記載の方法。

【請求項 29】

前記光学製品 (1) は、無限焦点、単焦点、二焦点、三焦点及び累進屈折力レンズから選択される眼科用レンズである、請求項 28 に記載の方法。

【請求項 30】

光学製品 (1) であって、前記製品の表面上に少なくとも 1 つの転写されたパターン (P) を備え、請求項 1 から請求項 29 のいずれか 1 項に記載の方法によって前記パターンの転写が行われる光学製品。

【請求項 31】

眼科用レンズであって、前記レンズは

- ・ 少なくとも 1 つの有機物または無機物の基板を備える基板レンズと；

- ・乾燥したラテックス層（２）と；及び

- ・接着剤の層によって前記基板レンズに接着することにより、転写されたパターンを形成する転写可能な材料の部分と；

を備える、請求項３０に記載の光学製品。

【請求項３２】

前記パターン（Ｐ）は、ラテックス層（２）上であって前記層に対し垂直方向において同じレベルに配置されているプリントされた材料のいくつかの部分によって形成され、転写された材料のない隙間（４ａ）によって分離される、請求項３１に記載の光学製品。

【請求項３３】

前記パターン（Ｐ）は、ラテックス層（２）内にエンボス成形され、及び転写された材料（３、４ｂ）のいくつかの部分は、前記ラテックス層内において異なるエングレーピング深さで配置される、請求項３１に記載の光学製品。

【請求項３４】

さらに、前記ラテックス層（２）は、その後に前記レンズが受けうる衝撃からの前記レンズ（１）の保護を形成する、請求項３１から請求項３３のいずれか１項に記載の光学製品。

【誤訳訂正２】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】０００６

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【０００６】

特開平０７ ２１９４３５号公報には、ホログラムリンカーの製造方法が記載されており、凹部及び突起部によって構成されるホログラムはまず熱可塑性材料の表面がエングレーピングされ、その後金属層によって覆われる。しかしながら、このようなプロセスにおいては、ホログラムによって占められる表面の一部に金属層を制限することが難しい。